２０２６年度第3回
フォトニックデバイス・応用技術研究会

テーマ『シリコンフォトニクス・異種材料集積技術』

日時：2026年10月21日(水)　　13:00 ～ 18:00　　（受付：12:30～）

会場：NTT 厚木研究開発センタ　1F　プレゼンルーム

主催： 一般財団法人光産業技術振興協会　フォトニックデバイス・応用技術研究会
協力： 株式会社オプトロニクス社、株式会社イーエクス プレス

講演プログラム　（講演順、講演題名は変更される場合があります）

13:00　～ 13:05
事務連絡・幹事挨拶

13:05　～ 13:55

（仮題）シリコンフォトニクスファウンドリーの現状と展望

タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社　　三橋 理一郎

13:55　～ 14:05　　休　　憩

14:05　～ 14:55

（仮題）400G/laneに向けたSiプラットフォーム上メンブレンInP系EA-DFBレーザ

NTT株式会社　　相原 卓磨

14:55　～ 15:05　　休　　憩

15:05　～ 15:55

CPO用高密度ポリマー光導波路付きガラス基板

大日本印刷株式会社　　北乾 巧也

16:00　～ 18:00

ポスターセッション・名刺交換会(懇親会(無料)を同時開催します)

研究会担当幹事：　NTT先端集積デバイス研究所　開 達郎
日本ルメンタム株式会社　足立 光一朗

【第5回研究会への特別聴講のご案内】

〇参加費（研究会非会員1人あたり、消費税込）

・一般：18,000 円

・会員/幹事と同じ企業の紹介者：8,000円（貴社所属の会員/幹事有無はお問い合わせ下さい）

・大学関係者、学生：1,500円

特別聴講
申込フォーム

〇特別聴講のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

https://forms.cloud.microsoft/r/7kmvgjnrYv

【研究会入会のご案内】

〇年会費：36,000 円（年度途中入会割引あり。お問い合わせ下さい。）

・本年度残り全ての定例研究会及びワークショップにご参加いただけます。

・会員限定サービスとしてリモート聴講もご利用いただけます。

入会申込フォーム

〇新規入会のお申し込み方法

下記URLまたは右記QRコードの申込フォームよりお申込みください。

https://forms.cloud.microsoft/r/2vKbvFM81T

【会場アクセス】

NTT 厚木研究開発センタ

〒243-0198　神奈川県厚木市森の里若宮3-1

小田急電鉄 愛甲石田駅北口からバスで約20分 / 本厚木駅東口からバスで約25分

https://www.rd.ntt/organization/access/atsugi.html

【問い合わせ先】

一般財団法人光産業技術振興協会

フォトニックデバイス・応用技術研究会 事務局（担当：瀬戸山）

TEL:03-5225-6431 FAX:03-5225-6435

E-mail：pdevice@oitda.or.jp

研究会ホームページ：

https://www.oitda.or.jp/study/pd/

研究会ホームページ

oitda　フォトニックデバイス